



### KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modułu	
Nazwa modułu	Ochrona własności intelektualnej
Nazwa modułu w języku angielskim	Protection of intellectual property
Obowiązuje od roku akademickiego	2012/2013

### A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Kierunek studiów	Inżynieria Środowiska
Poziom kształcenia	II stopień
Profil studiów	ogólnoakademicki
Forma i tryb prowadzenia studiów	stacjonarne
Specjalność	wszystkie
Jednostka prowadząca moduł	Katedra Strategii Gospodarczych
Koordinator modułu	Mgr Magdalena Kotulska
Zatwierdził:	Dr hab.Lidia Dąbek prof.PŚk, Dziekan WIŚGiE

### B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów	
Status modułu	Przedmiot obowiązkowy
Język prowadzenia zajęć	polski
Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr	I
Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim	Semestr letni
Wymagania wstępne	
Egzamin	Nie
Liczba punktów ECTS	1

Forma prowadzenia zajęć	wykład	ćwiczenia	laboratorium	projekt	Inne
w semestrze	15				



### C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

<b>Cel modułu</b>	Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dotyczącymi ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej, z uwzględnieniem wybranych aspektów ochrony własności przemysłowej w prawie europejskim.
-------------------	---

Symbol efektu	Efekty kształcenia	Forma prowadzenia zajęć (w/c/l/p/inne)	odniesienie do efektów kierunkowych	odniesienie do efektów obszarowych
W_01	Ma wiedzę nt. źródeł i struktury prawa własności intelektualnej. Potrafi zdefiniować i dokonać interpretacji podstawowych norm prawnych z zakresu ustawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej.	w	IŚ_W10	T2A_W10
W_02	Zna zasady ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej, w tym ochrony patentowej, przyjęte w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej. Rozumie znaczenie rozwiązań tej gałęzi prawa dla współczesnej gospodarki.	w	IŚ_W10	T2A_W10
U_01	Wykazuje umiejętność stosowania przepisów prawnych prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej w typowych sytuacjach faktycznych.	w	IŚ_U02	T2A_U01 T2A_U02 T2A_U07 T2A_U12
U_02	Potrafi w odpowiedzialny sposób korzystać z utworów, baz danych. Umie ubiegać się o ochronę dla poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej, tj. ochronę w postaci patentu, prawa ochronnego bądź prawa z rejestracji.	w	IŚ_U02	T2A_U01 T2A_U02 T2A_U07 T2A_U12
K_01	Zgodnie z prawem eksploatuje utwory chronione. Stosuje zasady poszanowania praw autorskich przy realizacji prac twórczych, w tym prac projektowych i dyplomowych.	w	IŚ_K02 IŚ_K08	T2A_K02 T2A_K03 T2A_K07
K_02	Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz postępować etycznie w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych.	w	IŚ_K01 IŚ_K05	T2A_K04 T2A_K05 T2A_K03 T1A_K07

### Treści kształcenia:

#### 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu

Nr wykładu	Treści kształcenia	Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu
1.	<b>Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Struktura wewnętrzna</li><li>Odrębność od innych gałęzi prawa</li><li>Modele ochrony dóbr intelektualnych</li><li>Funkcje prawa własności intelektualnej</li><li>Źródła prawa własności intelektualnej</li></ul>	W_01 W_02
2.	<b>Prawo autorskie i prawa pokrewne</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utwór jako przedmiot prawa autorskiego</li><li>Wyłączenia spod ochrony</li></ul>	W_01 W_02 U_01 U_02



	<ul style="list-style-type: none"><li>Bazy danych</li><li>Autorskie prawa majątkowe i osobiste</li><li>Rodzaje praw pokrewnych</li></ul>	K_01 K_02
3.	<b>Ochrona praw autorskich</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dozwolony użytek utworów</li><li>Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych</li><li>Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych</li><li>Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich</li></ul>	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
4.	<b>Plagiat i zagadnienia szczegółowe związane z prawem autorskim</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Istota plagiatu</li><li>Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu</li><li>Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów szkół wyższych z tytułu popełnienia plagiatu</li><li>Prawo autorskie w technologiach cyfrowych</li></ul>	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
5.	<b>Prawo patentowe i prawo wzorów użytkowych</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Urząd Patentowy RP – zadania, struktura</li><li>Przedmioty ochrony</li><li>Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej</li><li>Procedura rejestracji wynalazku i wzoru użytkowego w Polsce</li><li>Treść patentu oraz treść prawa ochronnego na wzór użytkowy</li></ul>	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
6.	<b>Prawo wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego i TUS</li><li>Procedura rejestracji wzoru przemysłowego i TUS w Polsce</li><li>Treść prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i TUS</li></ul>	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
7.	<b>Prawo oznaczeń odróżniających</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pojęcie, funkcje i rodzaje znaków towarowych</li><li>Prawo ochronne na znak towarowy – sposób nabycia, treść</li><li>Ochrona oznaczeń geograficznych</li></ul>	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
8.	<b>Ochrona własności przemysłowej w prawie europejskim – zagadnienia wybrane</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Patent europejski</li><li>Europejskie prawo wzorów przemysłowych</li><li>Wspólnotowy znak towarowy</li></ul>	W_01 W_02 K_01 K_02

### Metody sprawdzania efektów kształcenia

Symbol efektu	Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)
W_01	<b>Kolokwium zaliczeniowe</b> Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien znać źródła, strukturę i podstawowe normy prawne z zakresu ustawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo umieć dokonać interpretacji przepisów prawnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy – prawo własności przemysłowej.
W_02	<b>Kolokwium zaliczeniowe</b> Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien znać zasady ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo znać i rozumieć rolę i znaczenie know-how oraz ochrony dóbr intelektualnych w gospodarce, a zwłaszcza działalności przedsiębiorstw.



U_01	<b>Kolokwium zaliczeniowe</b> Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien wykazać umiejętność stosowania przepisów prawnych prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej w typowych sytuacjach faktycznych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo umieć dokonać własnej interpretacji i oceny analizowanych problemów.
U_02	<b>Projekt grupowy</b> Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien umieć wypełnić wniosek do Urzędu Patentowego RP o udzielenie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien umieć samodzielnie sporządzić podanie o udzielenie ochrony przez Urząd Patentowy RP dla danego przedmiotu własności przemysłowej.
K_01	<b>Projekt grupowy, w ramach którego studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia problemowe</b> Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien umieć zgodnie z prawem eksploatować utwory chronione, opracowując i prezentując wybrane zagadnienie problemowe z przedmiotu. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien umieć rzetelnie posługiwać się prawem cytatu w ramach przygotowywanych projektów.
K_02	<b>Projekt grupowy, w ramach którego studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia problemowe</b> Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien dobrze współpracować i pracować w grupie, aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów grupowych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo przejmować inicjatywę podczas prac w grupie oraz być w stanie sprawnie przygotować i prowadzić prace nad projektem.

### D. NAKŁAD PRACY STUDENTA

Bilans punktów ECTS		
	Rodzaj aktywności	obciążenie studenta
1	Udział w wykładach	15
2	Udział w ćwiczeniach	-
3	Udział w laboratoriach	-
4	Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)	3
5	Udział w zajęciach projektowych	-
6	Konsultacje projektowe	2
7	Udział w egzaminie	-
8		
9	<b>Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego</b>	<b>20h</b> <i>(suma)</i>
10	<b>Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego</b> <i>(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)</i>	<b>0,7 ECTS</b>
11	Samodzielne studiowanie tematyki wykładów	5
12	Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń	-
13	Samodzielne przygotowanie się do kolokwium	3
14	Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów	-
15	Wykonanie sprawozdań	-
15	Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium	-
17	Wykonanie projektu lub dokumentacji	2
18	Przygotowanie do egzaminu	-
19		
20	<b>Liczba godzin samodzielnej pracy studenta</b>	<b>10h</b>



		(suma)
21	<b>Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy</b> <i>(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)</i>	<b>0,3 ECTS</b>
22	<b>Sumaryczne obciążenie pracą studenta</b>	<b>30 h</b>
23	<b>Punkty ECTS za moduł</b> <i>(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)</i>	<b>1 ECTS</b>
24	<b>Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym</b> <i>Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi</i>	
25	<b>Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym</b> <i>(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)</i>	

### E. LITERATURA

Wykaz literatury	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adamczak A., du Vall M. (red.), <i>Ochrona własności intelektualnej</i>, wyd. UOTT UW, Warszawa 2010</li><li>2. Barta J., Markiewicz R., <i>Prawo autorskie</i>, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008</li><li>3. Czajka D., <i>Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne</i>, wyd. EWSPiA Warszawa 2010</li><li>4. du Vall M., <i>Prawo patentowe</i>, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008</li><li>5. Promińska U. <i>Prawo własności przemysłowej</i>, wyd. Difin, Warszawa 2005</li><li>6. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), <i>Prawo własności intelektualnej</i>, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011</li><li>7. Załucki M. (red.), <i>Prawo własności intelektualnej. Repetytorium</i>, wyd. Difin, Warszawa 2010</li></ol>
Witryna WWW modułu/przedmiotu	